



ПОЛЮС БАС

Установки фотолитографии серии GHS-401

**Техническая
информация**

Установки фотолитографии серии GHS-401

Установка фотолитографии GHS-401-A



Установка предназначена для фотолитографических процессов совмещения и экспонирования в мелко- и среднесерийном производстве интегральных микросхем, а также в исследовательских разработках.

Достоинствами модели являются простота в работе, высокая стабильность и повторяемость.

Параметр	Значение
Максимальный размер подложки	4" (Ø 100 мм)
Максимальный размер фотошаблона	5" (125 x 125 мм)
Точность совмещения	± 1 мкм
Разрешение	1.5 мкм (при вакуумном контакте)

Установка фотолитографии GHS-401-B



Установка предназначена для фотолитографических процессов совмещения и экспонирования в мелко- и среднесерийном производстве интегральных микросхем, а также в исследовательских разработках.

Источником засветки является светодиодная лампа УФ диапазона.

Достоинствами модели являются простота в работе, высокая стабильность и повторяемость.

Параметр	Значение
Максимальный размер подложки	4" (Ø 100 мм)
Максимальный размер фотошаблона	5" (125 x 125 мм)
Регулируемый зазор между подложкой и фотошаблоном	0~50 мкм
Точность совмещения	± 1 мкм
Источник засветки	УФ светодиодная лампа
Разрешение	1.5 мкм (при позитивном фоторезисте и вакуумном контакте)

ПОЛЮС БАС

☎ +7 (499) 444-70-45

✉ info@polusbas.ru 🌐 www.polusbas.ru